

공고특허97-007711

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 특허공보(B1)

(51) Int. Cl. 6
H04N 5/30
H01L 27/148

(45) 공고일자 1997년05월15일
(11) 공고번호 97-007711
(24) 등록일자

(21) 출원번호	특1993-0008468	(65) 공개번호	특1994-0027509
(22) 출원일자	1993년05월18일	(43) 공개일자	1994년12월10일
(73) 특허권자	경기도 수원시 팔달구 매안동 416번지		
(72) 발명자	김범식		
(74) 대리인	이영필 박영우 이윤민		

심사관 : 이현수 (특허공보 제5009호)

(64) 오버-플로우 드레인(OFD)구조를 가지는 전하결합소자형 고체촬상장치

요약

내용없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭] 오버-플로우 드레인(OFD)구조를 가지는 전하결합소자형 고체촬상장치 [도면의 간단한 설명] 제1도는 일반적인 전하결합소자형 고체촬상장치의 화소 레이아웃도.

제2도는 상기 제1도의 A-A'선 자른 종래의 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제3도는 상기 제2도의 B-B'선의 전위분포도.

제4도는 본 발명의 오버-플로우 드레인의 동작에 따른 신호전하와 입사조도와의 관계를 나타낸 다이아그램.

제5도는 본 발명의 오버-플로우 드레인구조에서 전자서터동작을 설명하기 위한 타이밍 차트.

제6도는 본 발명의 실시시에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제7도는 상기 제4도의 C-C'선의 전위분포도.

제8도는 본 발명의 다른 실시시에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제9도는 본 발명의 또다른 실시시에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

[발명의 상세한 설명] 본 발명은 전하결합소자(charge coupled device; 이하 CCD)형 고체촬상장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 특히 반도체기판의 표면층에 오버-플로우 드레인구조를 형성하여 온 칩(on chip) 회로를 실현할 수 있도록 구성된 CCD형 고체촬상장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.